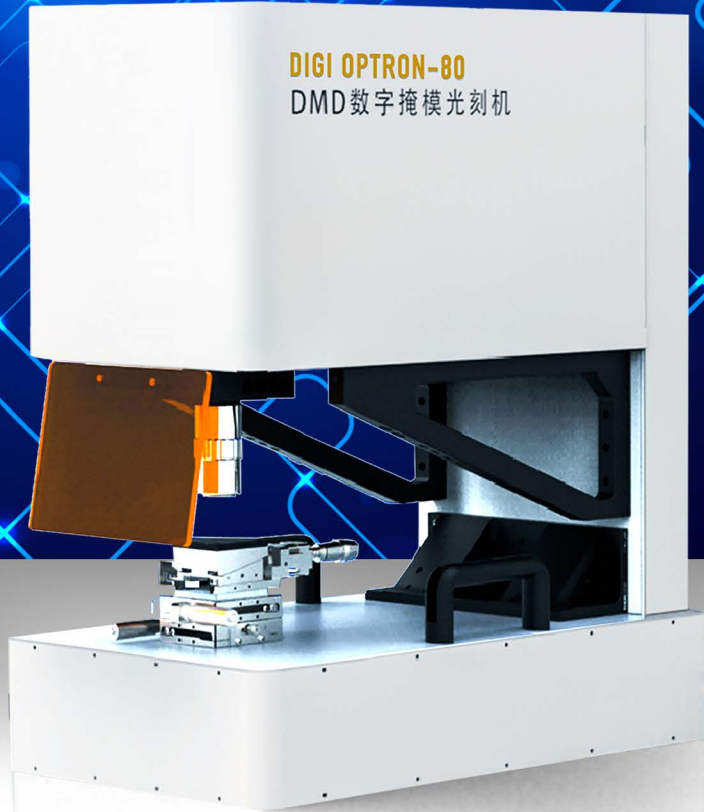
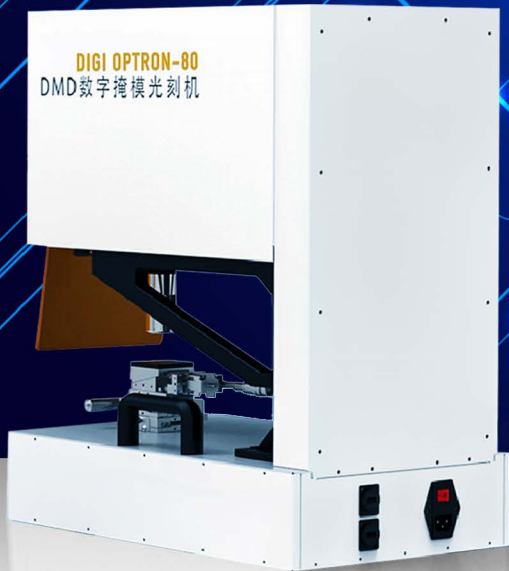




南京宁萃光学科技有限公司

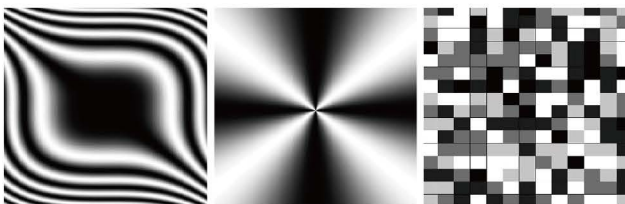


产品概述

DMD数字掩模光刻机无需制造掩模，采用DMD数字掩模可实现高精度，高分辨率，高对比度，高均匀性的任意图案曝光，并实现对任意区域紫外偏振敏感材料的偏振控制。结合高精度电动位移台可提升图像质量，用于偏振敏感光学元器件的制作。

应用领域

本产品可广泛应用于中小规模集成电路、半导体元器件、光电子器件和偏振防伪图案等的制作。



应用本装置制备的液晶聚合物光学元件

技术指标

性能参数

曝光光源	1.7W 405nm LED
调焦光源	1.0W 532nm LED
光源均匀性	>95%
DMD芯片像素	1920x1080 (7.56um/p)
单幅曝光尺寸	2.0x1.1mm (10x)
曝光倍率	2X、5X、10X
最高分辨率	2um (10X)
对焦精度	优于 $\pm 2\mu\text{m}$
样品台Z向定位精度	$\pm 0.5\mu\text{m}$
偏振对比度	>5000:1 @405nm
偏振角精度	$\pm 0.2^\circ$
外观尺寸	400mm(长)x300mm(宽)x600mm(高)



南京市江宁区东山国际总部园东麒路6号

胡清 15895987636



我们的使命：为液晶同行提供极具性价比的全方位支持与服务

OUR MISSION: TO PROVIDE COST-EFFECTIVE PRODUCTS AND SERVICES FOR LC RESEARCHERS